

大見研究室 和文 論文リスト

1997年

- 751(F) 大見忠弘、「一巻頭言ー大きな転換点を迎える半導体産業」、ウルトラクリーンテクノロジー、Vol.8、No.5/6、(半導体基盤技術研究会)、pp.292-296、1997年1月。
- 752(P) 大見忠弘、「21世紀の半導体集積回路」、極薄シリコン酸化膜の形成・評価・信頼性 特別研究会研究報告、((社)応用物理学会)、pp.1-10、1997年1月。
- 753(M) 大見忠弘、「サブオータミクロン時代における半導体生産技術」、M&E、Vol.24、No.1、(株)工業調査会)、pp.112-123、1997年1月。
- 754(M) 大見忠弘、「一年頭の辞ー水処理業界も意識改革を！」、用水と廃水、Vol.39、No.1、(株)産業用水調査会)、p.3、1997年1月。
- 755(M) 大見忠弘、「一巻頭言ーさらなる半導体産業の発展に向けた大学の新しい動きに期待する」、ブレークスルー、Vol.1、No.127、(株)リアライズ社)、pp.4-6、1997年1月。
- 756(M) 大見忠弘、「半導体技術の将来像」、電気学会誌、Vol.117、No.2、((社)電気学会)、pp.88-92、1997年1月。
- 757(P) 海原竜、竹脇利至、大見忠弘、新田雄久、「高信頼性銅ーマグネシウム合金配線技術」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.96、No.498、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号96-211、pp.39-44、1997年1月。
- 758(P) 大見忠弘、「次々世代に要求される技術は何か・・・新しい生産方式 Science and Technology in Future Semiconductor Manufacturing - Revolution of Manufacturing」、第11回 ISS ジャパン97講演集、(SEMI ジャパン)、pp.3-30、1997年2月。
- 691-2(M) 大見忠弘、「一巻頭言ーアドバンスドクォータマイクロン時代以降のシリコン結晶」、ウルトラクリーンテクノロジー、Vol.9、No.1、(半導体基盤技術研究会)、pp.2-9、1997年2月。
- 759(M) 大見忠弘、「機構解明したRCA洗浄を基に新しい枚葉式洗浄方法を提案」、日経マイクロデバイス1997年3月号、No.141、(日経BP社)、pp.90-95、1997年3月。
- 760(P) 余謨群、牛木健雄、森田瑞穂、大見忠弘、「タンタルゲート完全空乏化SOI MOSFET作製技術におけるプロセスガイドライン」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.96、No.571、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号SDM96-232、pp.29-36、1997年3月。
- 761-1(P) 大見忠弘、「プロセスガスを用いたサイエンティフィックマニュファクチュアリング」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 28、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.1-9、1997年3月。
- 762(P) 牛木健雄、余謨群、森田瑞穂、大見忠弘、「ウルトラクリーン低温プロセスを用いた高信頼性タンタルゲート完全空乏化SOI MOSFET」、1997年電子情報通信学会総合大会講演論文集、エレクトロニクス2、pp.349-350、1997年3月。
- 763(M) 大見忠弘、柴田直、「四端子デバイスエレクトロニクスが可能にする“しなやかな”情報処理電子システム」、電子情報通信学会誌、Vol.80、No.3、((社)電子情報学会)、pp.244-256、1997年3月。
- 764(P) 大見忠弘、「デバイスプロセスにおけるH₂O制御」、第44回応用物理学関係連合講演会講演予稿集、(応用物理学会、計測自動制御学会、日本結晶学会、日本真空協会、日本電子顕微鏡学会、日本物理教育学会、日本分光学会)、p.1400、1997年3月。
- 765(P) 森田瑞穂、関根克行、大見忠弘、「極限集積化デバイスのしきい値支配因子自己収束プロセスの研究ーCharging Control in X-Ray Photoelectron Spectroscopy by Xe Lamp Light Irradiation to Very Thin SiO₂/Si Interfaces」、平成8年度重点領域研究極限集積化・シリコン知能エレクトロニクス(269)、pp.172-175、1997年3月。

- 766(P) 柴田直、中田明良、山下雄一郎、森本達郎、周偉銘、菅田正宏、大見忠弘、「連想ハードウェアによる実時間知能情報処理システム」、平成 8 年度重点領域研究極限集積化シリコン知能エレクトロニクス(269)、pp.336-355、1997 年 3 月。
- 767(P) 大見忠弘、小谷光司、Ho-Yop Kwon、森本達郎、柴田直、今井誠、「Flexware ーしなやかで瞬時応答可能な知能集積システムー」、平成 8 年度重点領域研究 極限集積化シリコン知能エレクトロニクス(269)、pp.400-422、1997 年 3 月。
- 712-2(F) 大見忠弘、「次世代エキシマレーザステップが拓くリソグラフィ技術」、ウルトラクリーンテクノロジー、Vol.9、No.2、(半導体基盤技術研究会)、pp.64-82、1997 年 4 月。
- 768(F) 白井泰雪、大見忠弘、「エキシマレーザ用ガス配管システム」、ウルトラクリーンテクノロジー、Vol.9、No.2、(半導体基盤技術研究会)、pp.101-104、1997 年 4 月。
- 769(P) 大見忠弘、新田雄久、「エキシマレーザ、X線リソグラフィ時代の半導体生産技術、序文」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 30、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.5-6、1997 年 6 月。
- 770(P) 平山昌樹、大見忠弘、「RIE及びスパッタ用均一水平磁場均一高密度プラズマ装置」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 30、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.37-48、1997 年 6 月。
- 771(P) 平山昌樹、大見忠弘、「高品質成膜用マイクロ波励起高密度プラズマ装置」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 30、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.49-59、1997 年 6 月。
- 772(P) 大見忠弘、「エキシマ、X 線リソグラフィ時代の半導体生産技術」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 30、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.60-86、1997 年 6 月。
- 773(P) 乾實弦、那須悠一、大見忠弘、白井泰雪、「クリーンな高品質エピタキシャル成長」、超ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 30、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.192-200、1997 年 6 月。
- 774(P) 宮下雅之、藪根辰弘、菊山裕久、久次米孝信、大見忠弘、「枚葉ウエットエッチング」、超ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 30、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.203-212、1997 年 6 月。
- 775(P) 新田雄久、三木正博、藤田功、田代浩一郎、原田康之、川田和彦、大見忠弘、「枚葉ウエット洗浄装置」、超ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 30、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.213-229、1997 年 6 月。
- 776(P) 白井泰雪、橋本泰司、中村修、五十木幹彦、大見忠弘、「金属汚染を生じない特殊ガス供給系」、超ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 30、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.233-242、1997 年 6 月。
- 777(P) 伊野和英、関根克行、柴田直、大見忠弘、「不純物逆拡散を抑えたウルトラクリーン真空排気システム」、超ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 30、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.243-252、1997 年 6 月。
- 778(P) 岩本敏幸、大見忠弘、川田幸司、池田信一、皆見幸男、「新しい水分発生装置と極薄ゲート酸化膜形成技術」、超ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 30、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.253-259、1997 年 6 月。
- 779(P) 大見忠弘、「エキシマレーザ・リソグラフィ及びフッ化不動態配管技術」、第 15 回大阪酸素-半導体セミナー講演集、(大阪酸素工業)、pp.63-76、1997 年 6 月。
- 780(M) 矢崎洋史、泉浩人、中川佳紀、菊山裕久、大見忠弘、「F₂ ガスを用いた金属表面フッ化不動態処理」、溶融塩および高温化学、Vol.40、No.2、(溶融塩委員会)、pp.135-149、1997 年 3 月。
- 781(P) 大見忠弘、「Surface Chemical Electronics at the Semiconductor Surface」、第 45 回高分子夏季大学、講演要旨集、((社)高分子学会)、pp.1-17、1997 年 7 月。

- 782(M) 大見忠弘、「わが国の総合力を活用しよう」、応用物理、Vol.66、No.8、((社)応用物理学会)、p.787、1997年8月。
- 748-2(F) 大見忠弘、「半導体製造の今後の方向性」、ウルトラクリーンテクノロジー、Vol.9、No.4、(半導体基盤技術研究会)、pp.218-221、1997年8月。
- 783(M) 大見忠弘、森田博志、「第7章SiのCMP—IV洗浄—」、CMPのサイエンス、(サイエンスフォーラム)、pp.234-243、1997年8月。
- 784(P) 谷口祥之、伊野和英、大見忠弘、「タンタルシリサイドを用いた低リーク電流・低抵抗コンタクト形成技術」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.97、No.240、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号SDM97-95、pp.21-26、1997年8月。
- 785(P) 平山祐介、平山昌樹、高野晴之、大見忠弘、「均一水平磁場を用いた均一高密度プラズマプロセス用装置の開発」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.97、No.240、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号SDM97-103、pp.73-78、1997年8月。
- 786(M) 石原良夫、栗原信也、石原章次、都田昌之、大見忠弘、「ステンレス表面における微量水分の吸着—吸着熱および吸着等温式の検討—」、表面科学、Vol.18、No.9、(日本表面科学会)、pp.35-41、1997年9月。
- 787(P) 大見忠弘、白井泰雪、矢崎洋史、「反応性腐食性特殊ガス及びウェットプロセス用金属表面保護膜技術」、第44回材料と環境討論会講演集、((社)腐食防食協会)、pp.特1-4、1997年9月。
- 788(M) 大見忠弘、白井泰雪、「半導体工場におけるフッ化不働態処理技術の最新動向」、セミコンダクターアニュアル/ガス供給編、ガスメディア臨時増刊、((有)ガスメディア社)、pp.16-22、1997年10月。
- 789(P) 大見忠弘、「最新の半導体技術動向とCMPへの期待」、超LSIデバイスプロセスの機械的プラナリゼーション加工に関する研究会第19回研究会テキスト、(精密工学会)、1997年11月。
- 790(P) 中田明良、柴田直、菅田正宏、森本達郎、大見忠弘、「連想ハードウェアを目指した実時間動画像圧縮用LSI」、第1回システムLSI琵琶湖ワークショップ講演資料集およびポスター資料集、((社)電子情報通信学会)、pp.371-375、1997年11月。
- 791(P) 余寧梅、柴田直、大見忠弘、「ニューロンMOS重心検出器を用いたアナログファジィプロセッサ」、第1回システムLSI琵琶湖ワークショップ講演資料集およびポスター資料集、((社)電子情報通信学会)、pp.431-435、1997年11月。
- 792(P) 黄景宏、柴田直、大見忠弘、「アンチミラー効果を用いたCMOSランダムノイズ発生器」、第1回システムLSI琵琶湖ワークショップ講演資料集およびポスター資料集、((社)電子情報通信学会)、pp.449-453、1997年11月。
- 793(W) 伊野和英、平山昌樹、大見忠弘、「大口径ウェハ用プラズマプロセス技術(II)」、第8回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.12-18、1997年11月。
- 794(W) 大見忠弘、「エキシマ・X線リソグラフィ時代の半導体生産技術」、第8回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.62-88、1997年11月。
- 795(W) 五十木幹彦、橋本泰司、中村修、白井泰雪、大見忠弘、「超高純度ガス供給技術」、第8回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、ポスターセッション、pp.91-92、1997年11月。
- 796(W) 金本啓、中田明良、岡マウリシオ正純、玉井幸夫、大見忠弘、「低温アニールによる極浅・低リーク p⁺n 接合の形成」、第8回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、ポスターセッション、pp.93-94、1997年11月。
- 797(W) 松本哲理、岩本敏幸、大川猛、中村修、川田幸司、大見忠弘、「高信頼性極薄ゲート酸化膜形成技術」、第8回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、ポスターセッション、pp.95-96、1997年11月。
- 798(W) 中森光則、川田和彦、森田博志、岡野勝一、新田雄久、原田康之、大見忠弘、「全室温工程高速スピンド洗浄機の開発状況」、第8回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、ポスターセッション、pp.97-98、1997年11月。

- 799(W) 中田明良、米澤岳美、森本達郎、譽田正宏、柴田直、大見忠弘、「ベクトル量子化デジタルプロセッサの試作評価」、第 8 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、ポスターセッション、pp.101-102、1997 年 11 月。
- 800(W) 斉藤祐司、関根克行、平山昌樹、大見忠弘、「低イオン照射エネルギー・高密度プラズマによる Si 直接窒化膜の低温形成」、第 8 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、ポスターセッション、pp.103-104、1997 年 11 月。
- 801(W) 岡野勝一、金高宏明、大見忠弘、「次世代 CMP 技術」、第 8 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、ポスターセッション、pp.105-106、1997 年 11 月。
- 802(B) 大見忠弘、「第 4 章 超LSI材料 第 1 節 超LSIにおける高純度化概説」、高純度化技術大系 第 3 巻 高純度物質製造プロセス(株)フジ・テクノシステム、pp.782-805、1997 年 12 月。
- 761-2(M) 大見忠弘、「巻頭言 プロセスガスを用いたサイエンティフィックマニュファクチャリング」ウルトラクリーンテクノロジー、Vol.9、No.5/6、(半導体基盤技術研究会)、pp.274-285、1997 年 12 月。
- 803(P) 大見忠弘、新田雄久、「第 31 回超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムー序文」、第 31 回超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム 電子の発見 100 周年記念、トランジスタ発明 50 周年記念シンポジウム、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、1997 年 12 月。
- 804(P) 平山祐介、平山昌樹、高野晴之、大見忠弘、「BEDプラズマチャンバーによる大面積ダメージレスの微細パターンエッチング」、第 31 回超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム 電子の発見 100 周年記念、トランジスタ発明 50 周年記念シンポジウム、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.107-113、1997 年 12 月。
- 805(P) 仲野陽、福田航一、金聖哲、蛇口広行、笠間泰彦、小野昭一、大見忠弘、「電力効率の高い平行平板型プラズマプロセス装置」、第 31 回超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム 電子の発見 100 周年記念、トランジスタ発明 50 周年記念シンポジウム、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.114-123、1997 年 12 月。
- 806(P) 平山昌樹、関根克行、海原竜、大見忠弘、「マイクロ波励起高密度プラズマ装置」、第 31 回超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム 電子の発見 100 周年記念、トランジスタ発明 50 周年記念シンポジウム、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.124-132、1997 年 12 月。
- 807(P) 伊野和英、関根克行、柴田直、大見忠弘、「不純物逆拡散を抑えたウルトラクリーンガス排気システム」、第 31 回超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム 電子の発見 100 周年記念、トランジスタ発明 50 周年記念シンポジウム、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.141-150、1997 年 12 月。
- 808(P) 白井泰雪、橋本泰司、大見忠弘、板野充司、青山博一、「ステージドクリーンガス回収システム」、第 31 回超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム 電子の発見 100 周年記念、トランジスタ発明 50 周年記念シンポジウム、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.151-157、1997 年 12 月。
- 809(P) 林輝幸、斉藤美佐子、若林剛、松尾剛伸、若山恵英、岸野豊、小林貞雄、橋本泰司、川田和彦、西山泰史、大見忠弘、「クリーンルームエアからの有機物汚染」、第 31 回超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム 電子の発見 100 周年記念、トランジスタ発明 50 周年記念シンポジウム、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.161-170、1997 年 12 月。
- 810(P) 岩本敏幸、松木哲理、大川猛、中村修、大見忠弘、石原良夫、吉野通正、「酸化膜ドーパリ連続生成による超高信頼極薄ゲート酸化膜」、第 31 回超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム 電子の発見 100 周年記念、トランジスタ発明 50 周年記念シンポジウム、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.171-178、1997 年 12 月。
- 811(M) 大見忠弘、「特集、TFT-LCD用クリーンルームと自動化技術 ウルトラクリーンテクノロジーとTFT-LCD製造技術」、月刊LCD Intelligence、1998 年 1 月号、(株)プレスジャーナル、pp.71-76、1997 年 12 月。